Влияние толщины образца и дозы *у*-облучения на проявление радиационно-индуцированных оптических эффектов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках системы Ge-Sb-S

© Т.С. Кавецкий[†]*¶

[†] Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, 82100 Дрогобыч, Украина * Научно-производственное предприятие "Карат", 79031 Львов, Украина (Получена 24 августа 2010 г. Принята к печати 15 сентября 2010 г.)

Исследовано влияние толщины образца и дозы γ -облучения на величину суммарного и статического радиационно-индуцированных оптических эффектов в халькогенидных стеклообразных полупроводниках на примере сплавов системы Ge–Sb–S химического состава Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7}. Установлено, что при сопоставимых соотношениях между дозами γ -облучения ($\Phi = 3.0$ и 7.72 МГр) и толщинами образцов (d = 1.0 и 1.7 мм) изменение дозы значительно влияет на проявление радиационно-индуцированных оптических эффектов в данных полупроводниках.

Недавно в работах [1-5] нами было установлено, что высокоэнергетическое ионизирующее у-облучение халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) тройной системы Ge-Sb-S приводит к длинноволновому сдвигу их края оптического пропускания (края фундаментального поглощения), т.е. к эффекту радиационноиндуцированного оптического потемнения, и при этом данный эффект оказался нестабильным во времени. Иначе говоря, обнаружено, что суммарный радиационноиндуцированный оптический эффект содержит две составляющие: динамическую, которая затухает во времени, и статическую, которая остается стабильной на протяжении длительного времени, от 2-3 месяцев после у-облучения образца. Предполагается, что наличие статического и динамического радиационно-индуцированных оптических эффектов является универсальным для многих XCП [6-8], в которых можно наблюдать как оптическое потемнение, так и оптическое просветление под действием проникающей радиации.

Цель настоящей работы состоит в исследовании влияния толщины образца и дозы *γ*-облучения на величину суммарного и статического радиационно-индуцированных оптических эффектов в ХСП на примере сплавов системы Ge–Sb–S химического состава Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7}.

Исследуемые стекла синтезировались традиционным методом охлаждения расплава. Эксперименты проводились на образцах толщиной d = 1.0 и 1.7 мм, которые были получены разрезанием слитка на диски, шлифованием и полированием до необходимой толщины и требуемого оптического качества. Радиационная обработка образцов проводилась γ -квантами от источника 60 Со в стационарном поле радиации со средней энергией E = 1.25 МэВ при двух различных дозах: $\Phi = 3.0$ МГр для образцов с d = 1.0 мм, $\Phi = 7.72$ МГр для образцов

с d = 1.0 и 1.7 мм. Спектры оптического пропускания образцов регистрировались при комнатной температуре с помощью двухканального спектрофотометра "Specord M-40" в диапазоне длин волн $\lambda = 400-900$ нм. На поверхность образцов наносились специальные метки, что давало возможность неоднократно устанавливать их в рабочем отсеке прибора в одном и том же положении относительно падающего пучка зондирующего излучения. Максимальная погрешность измерения оптического пропускания не превышала 0.5%.

Спектры оптического пропускания $\tau(\lambda)$ в области края фундаментального поглощения для исследуемых образцов ХСП до у-облучения, через 1 и 60 дней после у-облучения приведены на рис. 1. Из рисунка следует, что ранее установленный длинноволновый сдвиг края оптического пропускания под действием радиации или эффект радиационного-индуцированного оптического потемнения при дозе $\Phi = 3.0 \, \text{MFp}$ для XCП системы Ge-Sb-S [1-5] наблюдается также и при дозе $\Phi = 7.72 \,\mathrm{M}$ Гр, причем эффект при большей дозе облучения оказывается гораздо более сильным. Это, очевидно, связано с процессами формирования радиационных дефектов, зависящими от дозы облучения. С другой стороны, также наблюдается увеличение эффекта радиационно-индуцированного оптического потемнения с увеличением толщины образца при одинаковой дозе облучения, что обусловлено накоплением радиационных дефектов по мере увеличения с толщиной массы образца. Однако этот процесс не такой эффективный, как в первом случае.

Для качественной оценки наблюдаемых явлений рассмотрим дифференциальные спектры оптического пропускания $\Delta \tau (hv)$ в шкале энергий фотонов hv, где $\Delta \tau$ соответствует разности коэффициентов оптического пропускания до и после γ -облучения образцов (рис. 2). Спектры $\Delta \tau (hv)$ являют собой колоколообразные кри-

[¶] E-mail: kavetskyy@yahoo.com



Рис. 1. Спектры оптического пропускания $\tau(\lambda)$ в области края фундаментального поглощения (500–650 нм) для образцов ХСП химического состава Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7} с толщинами d = 1.0 и 1.7 мм при дозах γ -облучения $\Phi = 3.0$ и 7.72 МГр: сплошная линия — до γ -облучения, штриховая — через 1 день после γ -облучения, штрихпунктирная — через 60 дней после γ -облучения.

вые с максимумом $\xi = \Delta \tau_{\text{max}}$, который соответствует величине максимального радиационно-индуцированного изменения оптического пропускания при фиксированной энергии фотонов [1,2].

Величины максимального радиационного-индуцированного изменения оптического пропускания для исследуемых образцов ХСП с толщинами d = 1.0, 1.7 мм при $\Phi = 7.72$ МГр ($\xi_{(1.0)}$ и $\xi_{(1.7)}$), а также при дозах γ -облучения $\Phi = 3.0, 7.72$ МГр и d = 1.0 мм ($\xi_{(3.0)}$ и $\xi_{(7.72)}$) и их относительное изменение ($\Delta \xi/\xi$)_d = ($\xi_{(1.7)} - \xi_{(1.0)}$)/ $\xi_{(1.7)}$ и ($\Delta \xi/\xi$)_{Φ} = ($\xi_{(7.72)} - \xi_{(3.0)}$)/ $\xi_{(7.72)}$ соответственно для суммарного (1 день после γ -облучения) и статического (60 дней после γ -облучения) эффектов приведены в таб-

лице. Из таблицы видно, что влияние толщины образца на величину суммарного и статического радиационных эффектов составляет $(\Delta\xi/\xi)_d = 15.1$ и 10.5% соответственно, тогда как влияние γ -облучения на величину суммарного и статического радиационных эффектов составляет $(\Delta\xi/\xi)_{\Phi} = 55.6$ и 61.6% соответственно.

Таким образом, можно сделать вывод, что при сопоставимых соотношениях между дозами γ -облучения ($\Phi = 3.0$ и 7.72 МГр) и толщинами образцов (d = 1.0и 1.7 мм) различие доз значительно сказывается на радиационно-индуцированных оптических эффектах в ХСП системы Ge–Sb–S. С физической точки зрения это значит, что зависимость процесса формирования ра-



Рис. 2. Дифференциальные спектры оптического пропускания $\Delta \tau (h\nu)$ для образцов ХСП химического состава Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7} с толщиной d = 1.0 и 1.7 мм при дозах γ -облучения $\Phi = 3.0$ и 7.72 МГр: штриховая линия — через 1 день после γ -облучения, штрихпунктирная — через 60 дней после γ -облучения. $\xi = \Delta \tau_{\text{max}}$ — величина максимального радиационно-индуцированного изменения оптического пропускания.

Величины максимального радиационно-индуцированного измененения оптического пропускания ($\xi = \Delta \tau_{\max}$) для образцов ХСП химического состава Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7} с толщинами d = 1.0, 1.7 мм при $\Phi = 7.72$ МГр ($\xi_{(1.0)}$ и $\xi_{(1.7)}$) и дозами γ -облучения $\Phi = 3.0, 7.72$ МГр при d = 1.0 мм ($\xi_{(3.0)}$ и $\xi_{(7.72)}$), их относительные изменения ($\Delta \xi / \xi$) $_d = (\xi_{(1.7)} - \xi_{(1.0)})/\xi_{(1.7)}, (\Delta \xi / \xi)_{\Phi} = (\xi_{(7.72)} - \xi_{(3.0)})/\xi_{(7.72)}$ соответственно для суммарного (1 день после γ -облучения) и статического (60 дней после γ -облучения) эффектов

Commence 20 (
Суммарный эффект 28.6 Статический эффект 22.9	33.7 25.6	15.1 10.5

d=1.0мм	$\xi_{(3.0)}, \%$	$\xi_{(7.72)}, \%$	$(\Delta\xi/\xi)_{\Phi},\%$
Суммарный эффект	12.7	28.6	55.6
Статический эффект	8.8	22.9	61.6

диационных дефектов от дозы *γ*-облучения преобладает над зависимостью процесса накопления радиационных дефектов от толщины образца ХСП.

Природа генерируемых у-облучением дефектов в ХСП следует из известной в литературе концепции пар с переменной валентностью (VAP), с перекоординированными и недокоординированными атомами [9], которая разработана на основании гипотезы Андерсона об эффективной отрицательной корреляционной энергии на U⁻-центрах [10] и представлениях о дефектах D^+ , D^- и D^0 [11]. Целый ряд работ (см., например, [12–17]) посвящен вопросам использования концепции VAP в XCП, в частности для интерпретации фотоиндуцированных явлений в аморфных *a*-Se, *a*-As₂Se₃ [12–14] и *a*-S, *a*-As₂S₃ [15,16]. Концепция VAP вместе с моделью деструкционно-полимеризационных превращений, или переключения химических связей, в аморфных полупроводниках, формируют концепцию координационных топологических дефектов (СТД) [18]. В рамках концепции CTD не собственные, а только индуцированные внешними факторами дефекты являются ответственными за структурные превращения в стеклообразной матрице. В случае ХСП системы Ge-Sb-S радиационные дефекты образуются вследствие переключения химических связей Ge-S на S-S, результатом чего является формирование пар CTD недокоординированных атомов германия и перекоординированных атомов серы $(Ge_3^-, S_3^+ [19-21])$. Бездефектное формировние связей Ge-Sb и Sb-Sb под действием у-облучения, которое наблюдалось для составов $Ge_{25}Sb_{15}S_{60}$ и $Ge_{35}Sb_5S_{60}$ [20], не влияет на изменение оптических свойств ХСП, как было установлено путем измерения спектров инфракрасного отражения в диапазоне $200-500 \text{ см}^{-1}$ для необлученных и у-облученных образцов [21]. Следует также отметить, что обсуждаемые дефекты СТД, которые ответственны за радиационно-индуцированные оптические эффекты в ХСП аннигилируют при температурах отжига начиная от пороговой температуры $T_{on} = 370-400$ K, не зависящей от химического состава ХСП, до некоторой температуры максимального восстановления T_{max} , увеличивающейся с увеличением температуры стеклования T_g [22].

В заключение отметим, что полученные сведения о влиянии толщины образца и дозы γ -облучения на проявление радиационно-индуцированных оптических эффектов в исследуемых ХСП системы Ge–Sb–S очень важны с целью их практического применения в качестве активных элементов дозиметрических систем. Предполагается, что аналогичные результаты могут наблюдаться и в других сплавах ХСП, которые характеризуются высокой чувствительностью к воздействиям проникающей радиации.

Автор выражает благодарность проф. В.М. Цмоцю (Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко) и проф. О.И. Шпотюку (Научнопроизводственное предприятие "Карат", г. Львов) за постоянный интерес к данной работе и полезные советы при обсуждении результатов.

Работа частично поддержана Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF) (проект CGP # UKE2-2816-LV-06) и Министерством образования и науки Украины (проект # 0109U007445).

Список литературы

- O.I. Shpotyuk, R.Ya. Golovchak, T.S. Kavetsky, A.P. Kovalskiy, M.M. Vakiv. Nucl. Instrum. Meth. B, 166–167, 517 (2000).
- [2] О.И. Шпотюк, Т.С. Кавецкий, А.П. Ковальский, Р.В. Луцив,
 В. Памукчиева. УФЖ, 46 (4), 495 (2001).
- [3] O.I. Shpotyuk, T.S. Kavetskyy, A.P. Kovalskiy, V. Pamukchieva. Proc. SPIE, 4415, 278 (2001).
- [4] O. Shpotyuk, T. Kavetskyy, J. Filipecki, A. Kovalskiy, V. Pamukchieva. *Scientific Works of Pedagogical University in Czetochowa. Chemistry* (Czetochowa, Poland, 2001) v. 5, p. 189.
- [5] O.I. Shpotyuk, R.Ya. Golovchak, A.P. Kovalskiy, T.S. Kavetskyy. Func. Mater., 10 (2), 317 (2003).
- [6] O.I. Shpotyuk, R.Ya. Golovchak, A.P. Kovalskiy, M.M. Vakiv, V.D.Pamukchieva, D.D. Arsova, E.R. Skordeva. Phys. Chem. Glasses, 42, 95 (2001).
- [7] A. Kovalskiy. J. Optoelectron. Adv. Mater., 3 (2), 323 (2001).
- [8] V. Balitska, R. Golovchak, A. Kovalskiy, E. Skordeva, O.I. Shpotyuk. J. Non-Cryst. Sol. 326–327, 130 (2003).
- [9] M. Kastner, D. Adler, H. Fritzsche. Phys. Rev. Lett., 37, 1504 (1976).
- [10] P.V. Anderson. Phys. Rev. Lett., 34, 953 (1975).
- [11] R.A. Street, N.F. Mott. Phys. Rev. Lett., 35, 1293 (1975).
- [12] A.V. Kolobov, K. Tanaka. ΦΤΠ, **32** (8), 899 (1998).
- [13] И.А. Васильев, С.Д. Шутов. ФТП, **32** (4), 490 (1998).
- [14] И.А. Васильев, С.Д. Шутов. ФТП, **33** (7), 863 (1999).
- [15] V.M. Lyubin, M.L. Klebanov. ΦΤΠ, **32** (8), 915 (1998).
- [16] С.А. Дембовский, А.С. Зюбин, Ф.В. Григорьев. ФТП, 32 (8), 944 (1998).
- [17] Л.П. Казакова, К.Д. Цэндин. ФТП, 33 (7), 866 (1999).
- [18] O.I. Shpotyk. Semicond. Semimet., 78, 215 (2004).

- [19] A. Kovalskiy, H. Jain, A. Miller, R.Ya. Golovchak, O.I. Shpotyuk. J. Phys. Chem. B, **110**, 22 930 (2006).
- [20] T. Kavetskyy, O. Shpotyuk, I. Kaban, W. Hoyer. J. Chem. Phys., **128** (24), 244 514 (2008).
- [21] T. Kavetskyy, O. Shpotyuk, V. Balitska, G. Dovbeshko, I. Blonskyy, I. Kaban, W. Hoyer, M. Iovu, A. Andriesh. Proc. SPIE, 7142, 71420B (2008).
- [22] O.I. Shpotyuk, A.P. Kovalskiy, T.S. Kavetskyy, R.Ya. Golovchak. J. Non-Cryst. Sol., 351, 993 (2005).

Редактор Л.В. Шаронова

Impact of the sample thickness and γ -irradiation dose on the occurrence of radiation-induced optical effects in chalcogenide vitreous semiconductors of the Ge-Sb-S system

T.S. Kavetskyy^{†*}

[†] Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,
82100 Drohobych, Ukraine
* Scientific Research Company "Carat",
79031 Lviv, Ukraine

Abstract The impact of the sample thickness and γ -irradiation dose on the magnitude of total and static radiation-induced optical effects in chalcogenide vitreous semiconductors is studied on the example of Ge–Sb–S alloys of the Ge_{23.5}Sb_{11.8}S_{64.7} chemical composition. It is established that at comparable ratios between the doses of γ -irradiation ($\Phi = 3.0$ and 7.72 MGy) and thicknesses of the samples (d = 1.0 and 1.7 mm), the dose change affects more essentially on the occurrence of radiation-induced optical effects in the semiconductors examined.